

OSK 75DU EASY-V シリーズ 比表面積およびポロシメトリー分析装置

OSK 75DU EASY-V シリーズEASY-Vシリーズは、比表面積試験と細孔径分析に静的体積法を採用したCIQTEK社の製品です。

高精度のデジタル圧力測定およびデータ収集システム、強力な抗干渉能力、高い拡張性、セクションごとに測定されるマルチレンジ圧力センサーにより、低圧測定にお

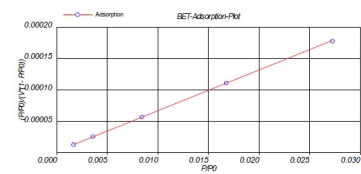
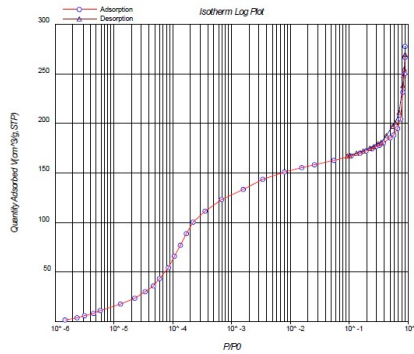
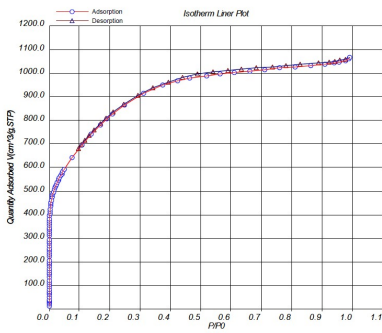
特長

- 10 インチタッチ スクリーン
- 4Lステンレス製インナーデュワー瓶
- 比表面積テストに最適なP₀チューブ
- ボールネジ型昇降システム
- 安全保護扉



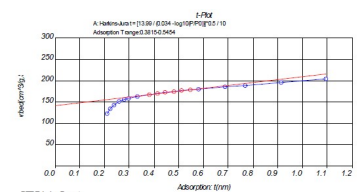
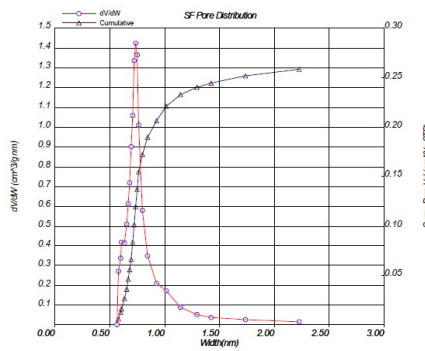
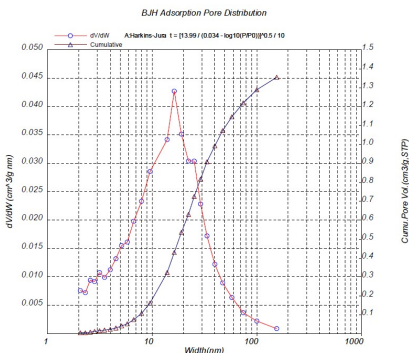
OSK 75DU EASY V シリーズ

分析レポート



BET Tabular Report

PP0	Quantity Adsorbed(mg)	(PP0)/(V*(1-PP0))	Single point BET
0.027194835851	137.7622285233	0.000177918489	682.519889933881
0.0146770332301	154.86437805489	0.000161917356	682.735848511913
0.008437190392	156.26290335831	0.000056261728	645.487927293296
0.00361888203	142.82288140210	0.00002573324	619.388614632934
0.001695877049	132.941978342067	0.000012778191	577.66507651644
Slope	Intercept	Vmm(g)	C Value
0.006443729611	0.00002255873	155.140130325603	3135.303564967590
R	Multi-BET Area	Langmuir Area	Pressure Curve
0.999997520615	675.243714200796	695.440114486853	




BET Tabular Report

PP0	Adsorbed Thickness(m)	Quantity Adsorbed(mg)			
0.368203	0.645420	177.769886			
0.316149	0.511793	175.778896			
0.265664	0.479030	173.540375			
0.213884	0.446838	171.481983			
0.166191	0.415003	169.248498			
0.118246	0.381594	166.879550			
Slope	Intercept	C	Micro Vd (mm³/g)	Micro Area(m²/g)	Internal Area(m²/g)
67.248593	141.205433	0.998767	0.219533	571.226685	104.017030

仕様

型番	OSK 75DU EASY-V 1220/1440	OSK 75DU EASY-V 3210/3220/3440
検査数	2 / 4	
比表面積範囲	N ₂ , CO ₂ , Ar, Kr, etc.	
テストガス	比表面積 0.0005 m ² /g 及びそれ以上; 比表面積再現性 ≤ ± 1.0% ≤ ± 1.0%	比表面積 0.0005 m ² /g 及びそれ以上; 比表面積再現性 ≤ ± 1.0%
孔径範囲	孔径: 2 nm-500 nm (メソ孔 とマクロ孔)	孔径: 0.35 nm-500 nm; (ミクロ多孔質とマクロ多孔質) 最も再現性の高い細孔サイズの偏差 ≤ 0.02 nm
p/p ₀ 圧力比	10 ⁻⁴ ~0.998	10 ⁻⁷ ~0.998
圧力センサー	3 Bar	3 Bar、1Torr、0.1Torr
真空システム	メカニカルポンプ到達真空度0.2 Pa	メカニカルポンプの到達真空度 0.2 Pa 分子ポンプの到達真空度 10 ⁻⁸ Pa
パイプライン機構	ステンレス鋼マイクロ溶接真空パイプラインシステム	
前処理ステーション	2 / 4	
脱気温度	室温~400℃	


オガワ精機株式会社 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 都新宿区大久保2-2-9
 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373 AX : 03-3200-0373
 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp ic2@dune.ocn.ne.jp
 Ver. 1.0 2023/9/22